

Support Fibre

Projet de procédé

Problématique

Projet EuHIT

Mesure de température dans un flux d'hélium cryogénique.

Fabrication de supports en silicium pour fibres de verre de diamètre 10µm.

La fibre possède un dépot métallique thermorésistif connecté électriquement au support.

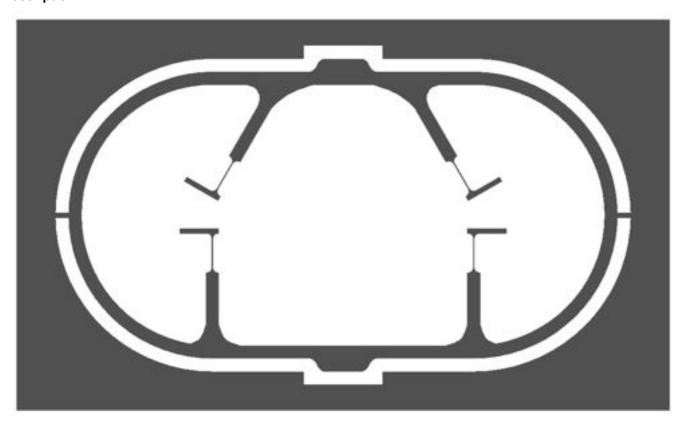
Le support a des électrodes en or pour mesurer la résistance électrique et déduire la température.

Le support doit perturber aussi faiblement que possible l'écoulement d'hélium.

Le support doit résister aux très basses températures (contraction thermique).

Le support doit résister aux vibrations dues à l'écoulement.

Description



La fibre est suspendue entre 2 plateaux rectangulaires distants de 10mm.

Chaque plateau est situé au bout d'un bras de 4mm.

Chaque bras a une partie flexible (fine) et une partie rigide (épaisse).

La partie flexible et le plateau sont amincis à 50µm pour donner une élasticité aux bras (absorption des contraintes mécaniques) et pour limiter les perturbations de l'écoulement.

Un cadre rigide porte les bras et entoure l'ensemble.

La surface est couverte par une couche d'or isolée du silicium par une couche de SiO₂.

Le cadre possède des emplacements pour les connexions électriques.

Pendant la fabrication, le cadre est relié au reste du wafer silicium par 2 ponts (en fin de procédé, les ponts sont cassés pour détacher le support).

Les angles sont arrondis et les axes cristallins sont décalés pour diminuer le risque de clivage.

Un support spécifique pourra être fabriqué par la suite pour fixer la fibre sans casser les plateaux ou les bras.



Dimensions

Wafer silicium

diamètre 100mm épaisseur 300µm polycristallin?

Plateau

longueur 1500μm largeur 200μm épaisseur 50μm

Espace entre les plateaux 10mm

Longueur bras 4mm environ

Angle plateau - grand axe 0° 30° Angle plateau - bras 90° Angle bras - cadre 90° 60°

Bras partie flexible

longueur 700μm 1500μm 3500μm largeur 50μm épaisseur 50μm

Bras partie rigide

largeur 500µm épaisseur 300µm

Cadre

espace intérieur 20mm x 10mm largeur poutre 500µm 1000µm épaisseur 300µm largeur emplacement connexion 1000µm largeur pont 200µm largeur fossé 500µm

Cellule masque 25mm x 15mm

Epaisseur SiO₂ 1µm méthode de dépot ? Epaisseur Cr 20nm Epaisseur Au 200nm



Masque face avant

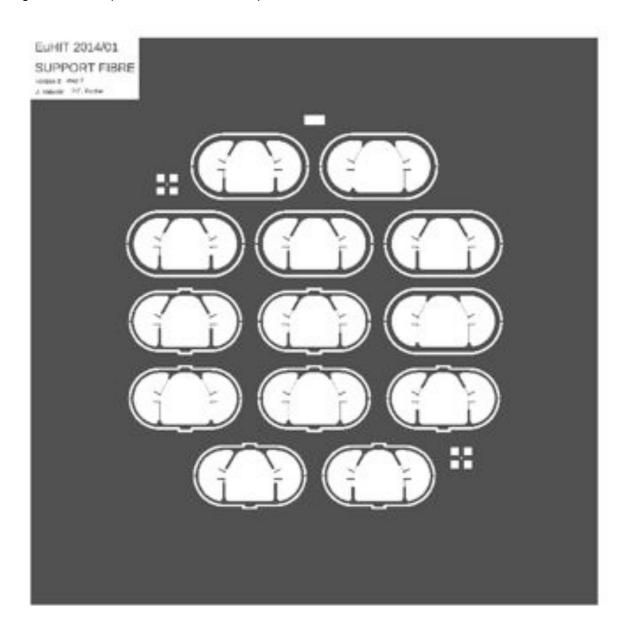
Nom : Support Fibre 2 Alignement face arrière Polarité : le gris est opaque Trait le plus fin : 50µm

13 dispositifs

Variation de la largeur de la poutre du cadre (500µm et 1000µm)

Variation de la longueur de la partie flexible du bras (700µm, 1500µm et 3500µm)

Croix alignement imbriquées : traits 1mm et 100µm





Masque face arrière

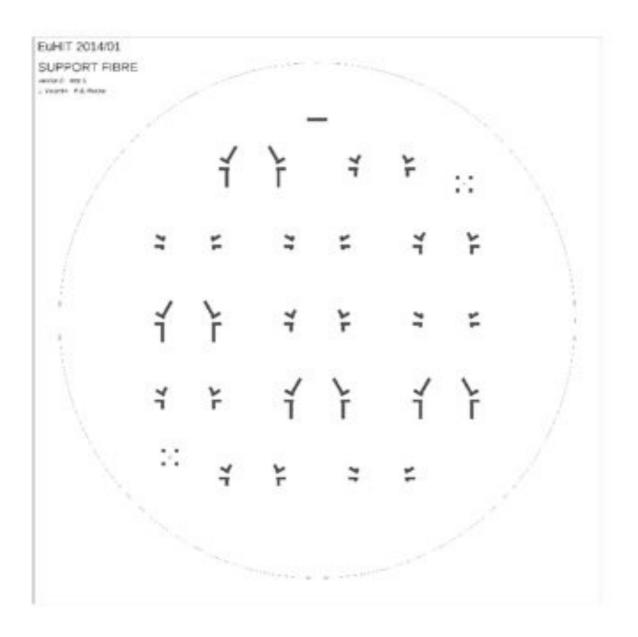
Nom : Support Fibre 1 Sans alignement

Polarité : le gris est transparent

Trait le plus fin : $600\mu m$ (sauf plots alignement $100\mu m$)

Symétrie miroir

Objectif : amincissement épaisseur 50µm pour le bras flexible et le plateau





Procédé prévisionnel

Départ

Wafer Si diamètre 100mm, épaisseur 300µm SiO2 thermique (pour isolation électrique) Orientation cristalline pour gravure humide ?



1. Photolithographie face arrière

Masque "support fibre 1"
Sans alignement
Résine positive 10μm (pour graver 200-300μm)
Nanofab ou PTA?

2. Gravure SiO2 face arrière

Problème étape 9 : arrêt de la gravure profonde de la face avant !

3. Gravure profonde face arrière

Gravure humide isotrope ? Gravure plasma XeF2 ? DRIE ? Nanofab ou PTA ? Gravure face arrière 200-300µm. Arrêt à 50µm de la face avant.

4. Délaquage résine



5. Dépot Cr Au face avant

Cr 20nm, Au 200nm Pleine plaque Pulvérisation cathodique (ou évaporation)

6. Photolithographie face avant

Masque "support fibre 2" Alignement face arrière Résine positive 6µm

7. Gravure Au Cr

Pulvérisation ionique ? Gravure humide ? Eau régale ou KI-I2 ?



8. Gravure SiO2 face avant

9. Gravure profonde face avant

DRIE obligatoire
Débouchant face arrière
Problème pour gérer l'arrêt de gravure sur les surfaces amincies à 50µm!
Clampage simple ? Collage ?
Suppression du SiO2 face arrière ?

10. Délaquage résine



11. Soudure fibre métallisée